

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所 / SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2025-11

ハイライト：

韓国の知的財産政策のコントロールタワー、「知識財産処」発足	1
サムスンも注目するイントゥセル、技術契約解除の特許問題とは？	2
今年上半期、韓国における国内出願は1.6%、海外出願は2.8%増加	3
「レーザーを1回当てただけ」複雑な半導体工程、時間もコストも大幅削減	4
遅れる商標審査、小規模事業者被害が拡大	5
「オボク・オボンジップ」、商標権侵害訴訟で勝訴...加盟店との共存と信頼を強化	6



IP制度

韓国の知的財産政策のコントロールタワー 「知識財産処」発足

- 知的財産紛争に戦略的に対応する組織を新設
- 知的財産の創出・活用および取引を担当する専任支援組織も整備

10月1日、政府組織法改正案の施行により、韓国特許庁は国務総理室所属の「知識財産処」に昇格し、新

たに発足した。

知識財産処の発足は、多様な形態の知的財産を統合・管理し、未来を先導する産業革新の基盤を整備するとともに、知的財産の創出や活用、保護機能を総合的に樹立することを目的としている。今後、知識財産処は韓国の知的財産政策のコントロールタワーとして、政府全体の知的財産政策の樹立および総括・調整業務を担うことになる。

今回の発足に合わせ、中核機能を強化するための組織改編も行われた。既存組織の規模は1官9局1団57課、3所属機関、1,785名であったが、改編後は1官10局1団62課、3所属機関、1,800名へと拡大した。

組織改編における最大の変化は、知識財産紛争対応局の新設である。従来、課レベルで担っていた業務を局レベルに拡大し、知的財産紛争の発生時に国家レベ

ルで迅速に対応できるよう支援する。また、機関ごとに分散している知的財産業務を総括・調整し、保護の死角が生じないようにするとともに、新規の知的財産に対する保護制度も整備する予定となっている。

知的財産の創出・活用および取引を担当する専任支援組織(改編：産業財産活用課 → 知識財産創出活用課、新設：知識財産取引担当課)も整備される。R&Dを通じて高品質な知的財産を確保し、取引や事業化によって収益を創出して、R&Dへの再投資につなげる「知的財産の好循環エコシステム」を提供することが目的である。知的財産の観点から韓国政府のR&Dおよび活用政策が策定されるよう、機関同士の協力を強化し、優れた知的財産が韓国経済の成長する原動力として刷新されるよう支援する方針である。

知識財産処は、韓国の知的財産政策のコントロールタワーとして、韓国の産業競争力の確保を支援する各機関が連携して取り組む政策の樹立を最優先課題として推進するとともに、韓国国民や企業が生み出した知的財産が市場で活発に取引され、誰もが知的財産紛争を憂慮することなく自由に活動できる環境を構築していく計画である。



紛争

サムスンも注目するイントゥセル

技術契約解除の特許問題とは？

ADC(抗体薬物複合体)プラットフォーム企業のイントゥセル社が特許問題に巻き込まれ、ABLバイオ社から技術導入契約を解除された。ADCプラットフォーム技術であるネクサテカンと同じ構造の薬物に関する中国特許が先に出願されていたことが遅れて明らかになったためである。特許問題が浮上したことで、イントゥセルと提携しているサムスンバイオエピス社にも業界の関心が集まっている。

業界関係者によると、ABLバイオは、昨年10月に締結したイントゥセルとのADCプラットフォーム技術導入契約の解除を通知した。イントゥセルから導入したネクサテカン技術に生じた特許問題により、当該技術の使用には、特許が確保されていない、または第三者の特許を侵害するおそれがあるという理由からである。

ABLバイオに契約解除に伴う違約金の支払い義務はないものの、すでに支払った契約金(アップフロントフィー)は取り戻せない。特許問題が生じた場合は契約金の返還請求が可能という意見もあるが、ABLバイオの関係者は、契約内容に従い契約金は返還されないことになったと説明している。

問題となった薬物は、30種類以上あるネクサテカンシリーズのうち「NxT3」である。イントゥセルは最近、FTO(特許侵害分析)の過程で、NxT3と同じ構造の薬物に関する中国特許が先に出願されていたことを確認した。この出願は、出願後18ヶ月間の非公開期間が保証されていたため、イントゥセルが特許を出願した時点では確認が不可能だった。

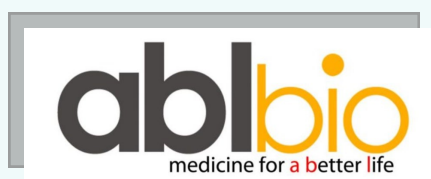
特許問題の報道を受け、イントゥセルの株価は急落した。この日午後にイントゥセルの株価は2万8,500ウォン前後

で取引されており、前取引日の終値(3万8,800ウォン)と比べて26.5%下落した。

イントウセルは今後、ネクサテカンシリーズの薬物を多角的にテストして開発する計画で、NxT3の特許取得等に向けての協議も並行して進めていく。一方、ABLバイオは複数の大手製薬会社との契約を基に、シナフィックス社のADCプラットフォーム技術を適用し、ABL206や209などの二重抗体ADCパイプラインを開発する方針である。

イントウセルとADC技術で提携中のサムスンバイオエピスは、現状では状況を見守る姿勢を示している。サムスンバイオエピスは2023年末にイントウセルとADC共同研究契約を結び、提携を続けている。イントウセルが独自のリンカーおよび薬物技術を提供し、サムスンバイオエピスが最大5つの抗がん標的に対するADC物質を製造して、特性を評価することが中核である。

業界関係者は、「今回のイントウセルの特許問題に関して、サムスンバイオエピスとABLバイオでは状況は異なる」と述べ、「ABLバイオは技術を導入した側であるため特許問題は致命的だが、サムスンバイオエピスは開発段階での提携にすぎず、打撃はない」と説明した。さらに「イントウセルの今後の方針や計画によって、サムスンバイオエピスの動きも変わってくるだろう」と付け加えた。



出願動向

今年上半期、韓国における国内出願は1.6%

海外出願は2.8%増加

今年上半期、韓国人による韓国国内および海外での出願がともに増加したことがわかった。

知識財産処によると、2025年上半期の韓国国内における特許出願は計10万9,322件で、前年同期(10万7,620件)より1.6%増加した。このうち韓国国籍の出願人による出願は8万3,815件で、前年同期(8万2,472件)より1.6%増加した。外国人による出願のうち、米国国籍および欧州国籍の出願人による出願はそれぞれ6.8%、1.8%減少した一方、中国国籍および日本国籍の出願人による出願はそれぞれ15.3%、7.2%増加した。

知識財産処は、中国国籍の出願人が大きく増えた背景について、中国国内市場の成長鈍化や米中貿易摩擦などを受け、中国企業が韓国市場を戦略的な拠点として活用していることを示していると説明した。

韓国人による海外での出願も活発で、今年上半期の五大特許庁(IP5)への特許出願は12万7,247件となり、前年比2.8%増加したことがわかった。

このうち、米国へ出願した特許件数は2万1,465件で、主要国(米国、中国、欧州、日本)への出願の中で最も多く、全体の49.5%を占めた。日本への特許出願は4,607件と18.2%増加し、最も高い増加率を記録した。

これは、韓国が海外市場進出に向け、米国と日本を中心に本格的なグローバル知的財産権の確保に乗り出していることを示している。

また、今年上半期の韓国国内の特許出願上位10分野のうち、AIや量子コンピューティング技術を含むICT関連産業の特許出願は1万4,089件で、前年同期比13.5%増加したことがわかった。

二次電池分野の特許出願は5,672件と前年同期比5.4%増加しており、特にLG、サムスン、SKなど韓国を代表する二次電池3大メーカーをはじめとする大企業を中心に特許出願件数が伸びた。

知識財産処は、これらの内容をまとめた2025年上半期の知的財産出願動向を「産業財産統計イシューレポート2025-3号」として刊行し、韓国知識財産研究院のウェブサイトで公開した。

知識財産処の知識財産情報局長は、「韓国人の特許出願の増加は、先端・主力産業分野で主要国間の競争が激化する中でも萎縮せず、技術開発に邁進している証拠だ」とし、「不安定な内外環境の中でも、韓国企業がAIや二次電池など未来産業の特許を基盤に危機を乗り越え、革新的に飛躍できるよう支援を惜しまない方針だ」と述べた。



最新技術

「レーザーを1回当てるだけ」

複雑な半導体工程、時間もコストも大幅削減

- DGIST(大邱慶北科学技術院)クォン・ヒョクジュン教授の研究チーム、レーザー基盤の酸化・ドーピング統合工程

電気電子コンピュータ工学科のクォン教授の研究チームが、たった1回のレーザー工程だけで半導体の伝導特性を転換する新たな技術を開発した。研究チームは、これまで電子中心によってのみ作動していた酸化チタン(TiO_2)を、正孔(hole)中心のp型半導体に変えることに成功した。研究チームが開発した「LODI(Laser-Induced Oxidation and Doping Integration)」技術は、たった1回のレーザー照射だけで酸化とドーピングを同時に実現可能なため、従来の複雑な

工程を画期的に簡素化する新たな転換技術として注目されている。

半導体は、電流を運ぶ主な粒子によって2種類に分けられる。n型半導体は、負の電荷を持つ電子(e^-)が移動して電流を流し、p型半導体は、電子の空席である正孔(h)が移動して電流を流す。スマートフォンやコンピュータなど、ほとんどの電子機器はこの二つの性質を両方活用するCMOS回路で作動している。したがって、n型とp型の両方が実現されて初めて効率的な回路設計が可能となる。

酸化チタン(TiO_2)は、毒性がなく、資源も豊富で、熱的・化学的な安定性に優れ、「理想的な半導体素材」として注目されてきた。しかし、結晶構造が非常に安定しているため、正孔の移動が制限され、電子(e^-)だけが伝達されるn型半導体としてしか作動しなかった。つまり、性能や安定性は優れていても、「回路の半分」しか使えない素材だったわけである。

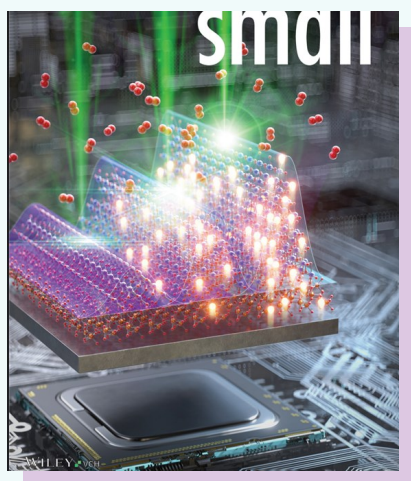
研究チームはこのような限界を克服するために、「LODI(Laser-Induced Oxidation and Doping Integration)」技術を開発した。この技術は、レーザー1回で酸化(oxidation)とドーピング(doping)を同時に行う統合工程であり、複雑な半導体製造プロセスを単一ステップに短縮できる。薄いチタン(Ti)金属薄膜の上にアルミニウム酸化膜(Al_2O_3)を重ねてレーザーを数秒間照射すると、チタンが酸素と結合して酸化チタン(TiO_2)に変化し、アルミニウムイオンが内部へ拡散する。この過程で電子のバランスが崩れ、正孔(hole)が生じ、結果として電子に代わり正孔が電流を運ぶp型半導体が形成される。

従来、酸化チタン半導体をp型に転換するには、高温熱処理や真空イオン注入など、数十時間に及ぶ複雑な工程が必要だった。また、高価な装備や高真空環境が求められるため、商用化には多くの制約があった。ところが、LODI技術を使えば、レーザー1回、わずか数秒で同じ効果が得られ、酸化・ドーピング・パターニングが同時に可能となり、工程にかかる時間とコストを劇的に削減できる、次世代の半導体製造技術として期待されている。

クォン教授は、「今回の研究は、n型としてしか活用できなかった酸化チタン半導体をp型に転換し、且つ従来の複雑

な工程を単一のレーザー工程に圧縮したという点で重要な意味を持つ」と述べ、「これは、酸化物半導体の伝導型を精密に制御可能とする基盤技術として、次世代の高集積・高信頼性素子の実現に向けた土台となるだろう」と明かした。

今回の研究成果は、国際学術誌「Small」の表紙論文(Front Cover)として正式に掲載された。



商 標

遅れる商標審査

小規模事業者被害が拡大

商標審査の遅れによる被害が深刻化しており、審査方式の根本的な見直しの必要性が提起された。商標登録は、事業者が自己の商品を他人の商品と区別するために申請する一種の「特許権」であって、登録が完了して初めて模倣品による侵害に対して損害賠償の請求が可能となる。

商標審査処理制度は、商標が法的に保護を受けるために知識財産処で審査を受ける手続きであり、商標出願 →

実体審査 → 出願公告 → 登録決定 → 商標権発生という順に処理される。

韓国国会の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会所属のキム・ドンア議員が、知識財産処から提出された年度別の商標審査処理現況によると、過去3年間(2022～2024年)の商標審査処理期間は、平均13.2ヶ月であることが分かった。この間の審査官1人あたりの年間処理件数は1,918件だった。

知識財産処が昨年8月に発表した商標審査処理期間の遅延による経済的被害額推定報告書によると、今年の商標審査遅延による被害額は14兆ウォン(約1兆4,800億円)に達する見通しである。

特に、小規模事業者や個人の被害が際立っており、年間売上高に対する被害規模はそれぞれ39.7%、51.9%と集計されている。報告書には、「商標登録前に海外で韓国の商標が無断で模倣された事例」や、「小規模事業者にとって商標未登録は即廃業に繋がる」という被害事例も含まれている。

キム議員は、「商標審査の遅延によって小規模事業者や個人が莫大な被害を受けている」とし、「審査官の人員を大幅に拡充し、審査過程で人工知能を導入するなど、制度的な改善が必要だ」と指摘した。

さらに、「トレンドの変化スピードが速まって、商標権の先取り競争が激化しているだけに、遅延による被害を最小限に抑えるため、韓国国会として最善を尽くす」と述べた。



「オボク・オボンジップ」

商標権侵害訴訟で勝訴

加盟店との共存と信頼を強化

韓食フランチャイズ「オボク(五福)・オボンジップ」が、商標権侵害訴訟で勝訴し、「オボンジップ」の商標権を守り抜いた。この判決は単なる商標権紛争にとどまらず、フランチャイズ業界全体に商標権管理の重要性を再認識させる事例として評価されている。

原告である「オボン・トシラク」は、2023年3月に「オボンジップ」が自社ブランドと類似しているとして、商標権侵害の訴えを起こした。

しかし法院は、オボン・トシラクとオボンジップでは、主力メニュー、価格帯、主な顧客層、運営方式において明確な違いがあり、オボンジップは、直火テナガダコ炒め、豚トロポッサム、マックスを大きな盆(オボン)に盛り付けて提供するという独創的なスタイルを確立しており、混同のおそれはないと判断した。

特に裁判部は、「オボンという語自体が盆を意味する一般名称であるため識別力が低い」と述べ、これを独占しようとする行為は商標権の濫用に該当する可能性があると指摘した。これは、過去にSBSの番組でも報道された商標権濫用問題とも通じる内容である。

ソウル北部地方法院は被告側の主張を認め、オボンジップに無罪を言い渡した。法院は、「識別力に乏しい標章をただ先に登録したというだけでは、独占権を行使できない」とし、商標権の濫用に法的な歯止めをかけた点で今回の判決には大きな意味があると述べた。

被告側の弁護士は、「今回の判決によってオボンジップのブランド価値を守り、数百の加盟店主が安心して商標を使用できるようになった」と説明した。

オボンジップ運営元の代表は、「商標権の保護と透明な経営は、加盟店の安定的な運営と顧客の信頼を確保するための中核である」と述べ、「本社は今後も商標権管理システムを強化し、加盟店との信頼関係を強化する取り組みを続けていく」と明らかにした。



韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA & HAにお任せ下さい

(調査・特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.com
Website : <http://haandha.com>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr